BL-10C/2013G118

ステレオコンプレックスポリ乳酸/シリカナノハイブリッドフィルムの 作製と微細構造

Preparation and Microstructure of Stereocomplex Poly(lactide)/Silica Nanohybrid Films

伊掛浩輝^{1,*},大澤雄貴²,小出優一郎²,高田昌子³,室賀嘉夫¹,栗田公夫¹,清水繁¹ ¹日大理工,〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台 1-8-14 ²日大院理工,〒101-8308 東京都千代田区神田駿河台 1-8-14 ³日大短大,〒274-8501 千葉県船橋市習志野台 7-24-1

Hiroki Ikake^{1,*}, Yuki Osawa², Yuichiro Koide², Masako Takada³,

Yoshio Muroga¹, Kimio Kurita¹, and Shigeru Shimizu¹

¹Coll. Sci. Tech., Nihon Univ., 1-8-14 Kandasurugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8308, Japan

²Grad. Sci. Tech., Nihon Univ., 1-8-14 Kandasurugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8308, Japan

³Jr. Coll., Nihon Univ., 7-24-1 Narashinodai, Funabashi, Chiba, 274-8501, Japan

1 <u>はじめに</u>

近年,植物や廃材などの微生物発酵により得られ る再生可能な資源を用いたバイオベースポリマーの 開発が進められている^[1]. その中でも, デンプンな ど多様なバイオマスを出発源とするポリ乳酸(PLA) は、化学的、物理的にも優れた特性を有しているこ とから,最も関心の高いバイオベースポリマーの一 つである. PLA の高機能,高性能化を図る上で,ポ リ-L-乳酸(PLLA)とポリ-D-乳酸 (PDLA)からステレ オコンプレックスポリ乳酸(sc-PLA)^[2]を作製する手 法が知られている. sc-PLA は緻密な結晶構造を形成 するために, 耐熱性や弾性率に優れた特徴を示す高 分子である.本研究では、sc-PLAの高度利用を目指 し,より耐熱性に優れかつ高温域でも靱性を持つ sc-PLA の創出を試みた.本法では、シランカップリ ング剤を用いて sc-PLA の改質を行い、その後、シ リカ(SiO₂)とハイブリッド化し、3次元ネットワーク 構造を有する sc-PLA/SiO, ハイブリッドフィルムの 作製を行った.得られたハイブリッドフィルムの熱 的性質及び微細構造について検討したので報告する.

2 実験

[1]PLAの末端修飾とステレオコンプレックス化

PLLA 及び PDLA はラクチドの開環重合^[3]により 得た.得られた PLLA 及び PDLA の粘度平均分子量 は 4.2×10⁴ と 4.3×10⁴,光学純度は 98.3 と 94.0%であ った.PLLA, PDLA 両末端に以下の方法でトリエト キシシリル(TES)基を導入した.PLLA または PDLA のテトラヒドロフラン溶液に、シランカップリング 剤である 3-アミノプロピルトリエトキシシラン (APTEOS)^[4]を入れ、反応温度 60°C,窒素雰囲気下 で 5 時間反応させ、PLLA 及び PDLA 鎖のカルボキ シル末端に TES 基を導入した ET-PLLA(I)、ET-PDLA(I)を得た.次に、ヒドロキシル末端には、上 述の条件で、3-イソシアネートプロピルトリエトキ シシラン(IPTEOS)^[5]を用い, TES 基を導入した ET-PLLA(II), ET-PDLA(II)を得た. ET-PLA 合成に際し て, PLA 末端基の反応性を考慮して, PLA(1mol)に 対して, APTEOS, IPTEOS とも 10 倍当量となるよ うに加えた. 得られた ET-PLLA(II)または ET-PDLA(II)を, 各々の濃度が 1%となるようにクロロ ホルムに溶解した後,等量混合し, 2 時間撹拌し, シャーレに展開しフィルムを作製した. これらのフ ィルムを 180℃ で 2 時間熱処理したものを測定試料 として使用した.

[2]ハイブリッドの物性評価

(1)熱重量分析(TGA)測定: セイコーインスツル製 TG/DTA-6200を使用した.シリカ複合量を調べる際 には,昇温速度10°C/min, 200mL/minの乾燥空気気 流中で,熱分解開始温度を調べる際には,昇温速度 20°C/min, 200mL/minの窒素気流中で測定した. (2)示差走査熱量計(DSC)測定: セイコーインスツル製 DSC-6100を使用し,昇温速度10°C/min, 50mL/min 窒素気流中で測定した. (3)動的粘弾性(DVA)測定: セイコーインスツル製 DMS-6100で, 温度範囲0~300°C, 昇温速度5°C/min, 周波数10Hz, 200mL/min窒素気流中で測定した. (4)X線広角回折(WAXD)測定:日本大学理工学部理工 学研究所材料創造研究センターPANalytical製X'Pert PRO MPDを使用した. 印加電圧, 電流は45kV, 40mA, ステップサイズ0.1°, スキャンスピード毎秒 0.02°, 走査範囲3~60°, 室温で測定した. (5)X線小角散乱(SAXS)測定:高エネルギー加速器研 究機構物質構造科学研究所放射光科学研究施設BL-10C酵素回折計を用いた.カメラ長2m,室温で測定 した. 散乱強度は透過率補正を行い, 過剰散乱強度 I(q)として求め、散乱波数ベクトル $q = (4\pi/\lambda)\sin(\theta/2)$] の関数として表した. λ はX線の波長で0.1488nm, θ は散乱角である.

3 結果および考察

3.1 ハイブリッドフィルムの熱的性質

Fig.1 に示す TGA 測定から,ハイブリッドフィル ム中に複合されるシリカ複合量を調べた.いずれの ハイブリッドにおいても,sc 結晶を形成することで 耐熱性が付与され,280°C 近傍まで安定した TGA 挙動を示す.その後,300 ~ 400°C の温度範囲で, 高分子主鎖の熱分解と燃焼に由来する顕著な減少が あり,約 600°C に至るまでの広い温度範囲で緩やか な重量%の減少がある.燃焼を終えた 600°C 以上の 残存重量では,いずれのハイブリッドにおいてもシ リカ複合量に応じた残渣量(7.7,16.6,19.2wt%)が示 され,TGA 曲線は一定となった.



Fig. 1 TGA curves of sc-PLA/SiO₂ hybrid films. (Heating rate 10°C/min, Air 200mL/min).

次に, TGA 曲線の重量減少開始部分から, ハイブ リッドの熱分解開始温度について検討した(Fig.2). 簡便な方法として, 初期重量に対して 5wt%重量減 少した温度を熱分解開始温度(T5)^{I6}として定義し評 価した. sc-PLA 単体では, T5 は 298°C であるが, シリカ複合量とともに開始温度が上昇し, 16.6wt% 以上シリカを複合すると, T5 は 338°C となり, sc-PLA に対して 40°C 程熱分解温度が上昇することが わかった. sc-PLA の耐熱性の良さは知られるとこ ろであるが, シリカとハイブリッド化することで, sc-PLA にさらに耐熱性が付与できることが示された.

ハイブリッドフィルムの耐久性の指標となる熱分 解反応における活性化エネルギー(*Ea*)を小澤法^{[7], [8]} から求めた(Fig.3). PLLA 単体では,*T5=292°C*, *Ea*=101kJ/mol と最も低い値を示すが,これをハイブ リッド化し、シリカを 14.4wt%複合した場合では, *T5=*337°C, *Ea*=145kJ/mol と、複合効果によって熱 分解が抑制されるが、シリカ複合相当の増加であっ た.しかし、シリカ量が 16.6wt%とほぼ同量である が、sc-PLA/SiO₂ ハイブリッドでは、シリカによる 複合効果に加えて sc 化することで *Ea* は 177kJ/mol まで増加し、比較試料の中で最も高い値を示した. PLLA 単体および PLLA のハイブリッド化よりも, sc 化によってより安定な構造が内部で形成されるものと考えられる.

これらの結果から,ハイブリッド化した場合でも, PLLA と PDLA とで sc 構造が形成され,高温領域で も耐熱性が保持できたと推察される.さらに,複合 シリカが PLA マトリックス中に単に分散するだけ ではなく,シランカップリング処理したことによっ て,TES 基とシリカとが共有結合するためにより高 温度域でも耐熱性の維持に繋がったと考えている.

Fig.4 に示す sc-PLA 及び sc-PLA/SiO₂ ハイブリッドフィルムの DSC 測定から, sc-PLA では,約230~240°C 付近に sc 結晶の融解に伴う吸熱ピーク^[9]が観測された.また,約210~230°C 付近にもブロードなピークがあるが,これは sc-PLA を形成する際に生じるメゾ結晶に由来する吸熱ピークと推察している.



Fig. 2 TGA curves of sc-PLA and sc-PLA/SiO₂ hybrid films. (Heating rate 20° C/min, N₂ 200mL/min).



Fig. 3 Logarithmic heating rate $\log\beta$ vs inverted temperature 1/T for PLLA, PLLA/SiO₂, sc-PLA, and sc-PLA/SiO₂ hybrid films.



Fig. 4 DSC curves of sc-PLA and sc-PLA/SiO₂ hybrid films.

しかし, PLLA 単体からなる結晶融解挙動は見られ なかった.そこで,この融解ピークから,次式によ り結晶化度 X_eを算出した.

$$X_c = \frac{\Delta H_e}{\Delta H_m^0}$$

ここで、*ΔH*。は実測の融解エンタルピーで sc-PLA で は約 102mJ/mg であった. また, ΔH_m^0 は sc-PLA 完 全結晶の融解エンタルピーで $\Delta H_m^{0}=155 \text{mJ/mg}^{[9]}$ とし た. これらの値から X は大凡 65.8%であることがわ かる.これにシリカを複合することで、いずれの組 成においても, sc-PLA で観測された約 230 ~ 240℃ 付近の sc 結晶に基づく吸熱ピークが見られず, 200 ~ 230℃ 付近にブロードな吸熱ピークが観測される ようになった. また, シリカを 7.7wt%複合したハ イブリッドでは、160~170℃付近にも微弱である が吸熱ピークが観測され、これは PLLA に由来する home 結晶の融解に伴う吸熱ピークと考えている. sc-PLA 単体に比べて、いずれのピークもブロードで 微弱なため X の算出には至らなかったが、両末端に シリカが導入されたことで,ハイブリッド内部での sc の結晶化が抑制され, また, これに伴い, 微細な 結晶が形成されたのではないかと推察している.

Fig.5 に sc-PLA 及び sc-PLA/SiO₂ ハイブリッドの 温度依存性における DVA 曲線を示すが, sc-PLA 単 体では, 220°C 付近から sc 結晶が融解するために貯 蔵弾性率 E'が急激に低下する.シリカを 7.7wt%複 合したハイブリッドでは, DSC 挙動で述べた通り, sc 結晶の他に, PLLA の home 結晶や微細な結晶が 含まれるために, これらを反映して複雑な DVA 挙 動を示すが, いずれの温度領域においても低い E'値 を示した.また, 13.6wt%シリカを複合した場合で は, DVA 曲線の乱れは少ないが, ハイブリッド内 部で sc 結晶が形成しづらいため, sc-PLA 単体より も低温度で流動域が発現する.これらに対して, 16.6wt%以上複合した場合では, 200°C 以上の温度 領域でゴム状プラトーを示し, sc 結晶の融点よりも



Fig. 5 Dynamic viscoelastic properties of sc-PLA and sc-PLA/SiO₂ hybrid films.

高い 300℃ 付近まで高い弾性率を保持することがわ かった. 複合したシリカ量が多く,このため,ハイ ブリッド内部でシリカを介して3次元網目構造が形 成したためであると考えている.

次に,損失正接 tan δピークを見ると, sc-PLA 単体 の場合では,フィルム内部で sc 結晶が形成される ため,約 80℃ にピークが観測されるが,ハイブリ ッド化することで, sc 結晶の形成の抑制,並びに PLLA の homo 結晶や微細な結晶が含まれることか ら,PLA マトリックスの補強にはあまり繋がらず, ピーク位置も約 70℃ 付近まで低温側にシフトし, ピーク高さも sc-PLA 単体よりも高い値を示した. シリカ複合量を増やすことで,ピーク位置はほぼ変 わらずに約 70℃ 付近であったが,複合したシリカ による補強効果によってピーク高さが低くなってい るものと窺える.このため,高温域でも熱的安定性 が向上したものと考えられる.

3.2 ハイブリッドフィルムの微細構造

Fig.6 に sc-PLA/SiO₂ハイブリッド及び sc-PLA フ ィルムの WAXD 測定結果を示す. sc-PLA 単体の WAXD パターンから,回折角0で約 12, 21, 24°付 近にそれぞれ sc 結晶を特徴付ける(110), (300)/(030), (220)面に基づく回折ピーク⁽⁹⁾が観測された.これに, シリカを複合することで、これらのピークがややブ ロード化していることが見て取れる.また,シリカ 量が多くなるとともに、これらのピーク強度が減少 していることがわかる.しかしながら、複合量が多 くなった場合でも、シリカに基づく回折ピークが全 く観測されていないことから、ハイブリッド内部の シリカは無定型であると考えられる. これらのこと から、複合したシリカは無定型であり、複合量の増 加に伴って, sc 結晶の形成を妨げているものと推察 される. 一方で, PLLA または PDLA の homo 結晶 に由来するような明瞭な回折ピークも観察されてい ないことから、PLAマトリックスは理想鎖に近しい



Fig. 6 WAXD patterns of sc-PLA and sc-PLA/SiO₂ hybrid films.

挙動を示すが、PLLA と PDLA が隣接した部位においては、完全な sc 結晶の形成よりもメゾ構造的な sc 結晶の形成が生じているものと推察する.

次に, sc-PLA/シリカハイブリッド, sc-PLA フィ ルムの SAXS プロファイルを Fig.7 に示す. いずれ のフィルムにおいても SAXS 挙動に熱揺らぎによる 散乱が見られたので,これを Ruland の経験則^[10]に 従い除去した.

sc-PLA 単体では, *q*=0.3nm⁻¹付近に sc 結晶の長周 期構造に基づくと判断されるブロードな SAXS ピー クが観測されるが,シリカを複合することによって, いずれの複合量においても, sc 結晶に関係づけられ る SAXS ピークは不明瞭となり判別が難しくなって いる.シリカを複合することで,シリカの電子密度 が PLA に対して大きいために, Fig.7 に示されるよ うに,ほぼすべての *q*レンジにおいて,相対的であ るが sc-PLA に比べて *I(q)*が高くなる傾向が示される. 内部構造を明らかにするために,広角側の広い (Porod)領域において,フラクタル挙動から推察した. 同領域でのフラクタル挙動は,以下の式に従うこと が知られている^{[11],[12]}.

$I(q) \propto q^{-D}$

ここで, Dはフラクタル次元である. Dの値は, シ リカを複合することで,増加する傾向が見られる. シリカが 7.7wt%複合したハイブリッドでは D=3.2 程度となり,さらに複合した 19.2wt%では約 4 とな った. このことから,複合したシリカは,高度に分 岐した 3 次元構造を形成するとともに,シリカ表面 は滑らかな状態であることが窺える.また, D=4 と なったことから,シリカは PLA マトリックス中に ランダムに分散している,すなわち,シリカとマト リックスの境界面がシャープな二相系としてハイブ リッド化していることが示唆される.



Fig. 7 Thermal fluctuation corrected SAXS profiles of sc-PLA and sc-PLA/SiO₂ hybrid films.



Fig. 8 Lorentz-corrected SAXS profiles with subtraction of the thermal fluctuations for sc-PLA and sc-PLA/SiO₂ hybrid films.

次に、Lorentz 補正を行う. 横軸を散乱波数ベク トル q, 縦軸に q の 2 乗と散乱強度 I(q)の積との関 係を図示した (Fig.8). 先の sc-PLA 単体では, q=0.31nm⁻¹近傍に顕著に SAXS ピークの極大(q_{max})が 観測される. この q_{max} に対して,簡便な近似ではあ るが、以下の式に示す Bragg の近似式に従い、sc 結 晶間の干渉間距離(L)を算出したところ、大凡である が、L=20.0nm となることがわかった.

$$L = \frac{2\pi}{q_{max}}$$

しかし、シリカを複合した場合となると、Fig.8 においても sc 結晶に由来する干渉ピークを見るこ とはできないが、新たに Fig.8 中の矢印(↓)で示すよ うなシリカ間の干渉に由来するショルダーもしくは ピークが観測されるようになった. 図示するように, 直線(破線)の交点より得られる q_{max} の値は,シリカ 複合量に応じて,小角(低 q 値)にシフトしており, また,ショルダーから明瞭なピークに変化している ことがわかる. このことから,複合されるシリカは, ハイブリッド内部でランダム分散しているが,複合 量に応じてシリカドメインサイズも大きくなってい ることが推察される. そこで,Fig.7 の SAXS デー タから,詳細な微細構造解析を試みた.一定の電子 密度を持つ 2 相がランダムに分布しているような系 を考えた場合,散乱強度 *I*(*q*)は,次式で表すことが できる.

$$I(q) = I_e(q) \langle \eta^2 \rangle V \int_0^\infty \gamma(r) \frac{\sin(qr)}{qr} 4\pi r^2 dr$$

ここで、 $I_{\ell}(q)$ は 1 個の電子による散乱強度、 $\langle \eta^2 \rangle$ は 電子密度の揺らぎの2乗平均、Vは照射体積、 $\gamma(r)$ は 電子密度相関関数である. 距離 r が 0 から∞まで変 化する際、 $r \rightarrow 0$ のとき、 $\sin qr/qr \rightarrow 1$ 、 $\gamma(0) \rightarrow 1$ である ので、逆フーリエ変換によって $\gamma(r)$ が得られる.



Fig. 9 Three-dimensional correlation function $\gamma(r)$ of sc-PLA and sc-PLA/SiO₂ hybrid films.

Fig.9 は、シリカ複合量の異なるハイブリッドおよび sc-PLA 単体について、y(r)と距離 r との関係ついて図示した. sc-PLA 単体では、r=23nm 付近にブロードなピークが見られるが、これは、これまで述べてきた通り、sc 結晶の長周期構造に相当する長さである.しかし、シリカを複合したハイブリッドでは、いずれの複合量においても明瞭な変化を見ることができなかった.この原因としては、複合されるシリカが、ハイブリッド内部にランダムに分散していることと、PLLA と PDLA からなる sc 結晶およびメゾ結晶からの様々な散乱挙動が含まれるために、クリアな相関として現れなかったと推察している.

4 まとめ

L 及び D-ラクチドの開環重合によって得た PLLA と PDLA を、2 種類のシランカップリング剤で両末 端に TES 基を導入した ET-PLLA(II)と ET-PDLA(II) を合成した. これらを用いて、ゾル-ゲル法により PLLA/SiO₂ と PDLA/SiO₂を調製し、クロロホルム溶 媒で sc-PLA/SiO₂ ハイブリッドフィルムを作製した.

sc-PLA/SiO₂ハイブリッドの耐熱性は, sc-PLA よ りも熱分解温度が 40℃ 程上昇した. 同程度シリカ を複合した PLLA/SiO, ハイブリッドよりも熱的安定 性が向上した. ハイブリッド中の sc 結晶の融解挙 動から、PLA の homo 結晶に由来するような融解挙 動は見られなかったが、ハイブリッド内部では、sc 結晶も形成するが, sc メゾ結晶も含まれていること が示唆された.動的粘弾性挙動では、シリカ複合量 の少ない場合では、sc-PLA 単体よりも低温度で流動 域を迎える.シリカ量が多いハイブリッドでは, 200°C 以上の高温度域でゴム弾性挙動を示し, sc 結 晶の融点以上でも高い弾性率を示した.シリカを複 合することで, sc 結晶の形成が抑制されるが, シリ カが架橋点となり,ハイブリッド化することで, sc-PLA 単体よりも優れた熱的特性を示すことがわか った. また, 併せて PLA の熱分解反応も抑制させ れることが明らかとなった.

謝辞

本研究は、日本大学学術研究戦略プロジェクトの 一環として実施された.また、高エネルギー加速器 研究機構物質構造科学研究所放射光科学研究施設 (BL-10C)における共同利用実験(課題番号 2011G070 および 2013G118,研究代表日大理工伊掛浩輝)とし て実施された.物質構造科学研究所五十嵐教之准教 授,清水伸隆准教授,並びにスタッフ皆様に改めて ここに深く謝意を表す.

参考文献

- [1] Y. Kimura, *Polym. J.*, **41**, 797 807 (2009).
- [2] H. Tsuji, *Macromol. Biosci.*, **5**, 569 597 (2005).
- [3] Y. Koide, H. Ikake, Y. Muroga, S. Shimizu, *Polym. J.*, 45, 645 - 650 (2013).
- [4] H. Wang, M. Fang, T. Shi, L. Zhai, C. Tang, J. Appl. Polym. Sci., 102, 679 - 683 (2006).
- [5] A. Helminen. H. Korhonen. J. V. Seppälä, *Polymer*, 42, 3345 - 3353 (2001).
- [6] 神戸博太郎,小澤丈夫編,"新版熱分解",株式会 社講談社,(1992),194-207.
- [7] T. Ozawa, Bull. Chem. Soc. Jpn., 38, 1881 1886 (1965).
- [8] 小澤, Netsu Sokutei, 31, 125 132 (2004).
- [9] D. Sawai, Y. Tsugane, M. Tamada, T. Kanamoto, M. Sungil, S. H. Hyon, J. Polym. Sci. Pt. B. Polym. Phys., 45, 2632 - 2639 (2007).
- [10] W. Ruland, Colloid & Polym. Sci., 255, 417 427 (1977).
- [11] D. W. Schaefer, Science, 243, 1023 1027 (1989).
- [12] D. W. Schaefer and K. D. Keefer, *Mater. Res. Soc. Symp. Proc.*, **32**, 1 14 (1984).